

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗМЕРНОСТИ ЭКСИТОННЫХ СОСТОЯНИЙ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ С НЕСИММЕТРИЧНЫМИ БАРЬЕРАМИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Ю.А.Алещенко¹⁾, И.П.Казаков, В.В.Капаев, Ю.В.Копаев

Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН

117924 Москва, Россия

Поступила в редакцию 5 января 1998 г.

В структурах одиночных квантовых ям GaAs/Al_xGa_{1-x}As с асимметричными барьерами обнаружена 2D-3D трансформация размерности экситонных состояний с ростом внешнего электрического поля. В обширной области изменения поля энергия связи 2D экситона остается постоянной, так как ее уменьшение компенсируется все большим проникновением электронной волновой функции в барьерный слой, где за счет большей эффективной массы и меньшей диэлектрической проницаемости AlGaAs по сравнению с GaAs энергия связи экситона выше. Когда максимум электронной волновой функции при увеличении поля смещается в барьер, энергия связи экситона уменьшается. При дальнейшем росте поля происходит трансформация 2D экситона в квази-3D экситон, в состав которого входят тяжелая дырка в квантовой яме и электрон резонансного надбарьерного состояния.

PACS: 71.50.+t, 73.20.Dx, 78.55.Cr

Задача об уровнях энергии в потенциальной яме с асимметричными барьерами хорошо известна из квантовой механики [1]. В отличие от ямы с симметричными барьерами, где всегда есть по крайней мере один уровень энергии, наличие связанного состояния для частицы с массой m в прямоугольной яме шириной d с барьерами $U_1 \neq U_2$ и массами m_1, m_2 определяется условием

$$d \frac{\sqrt{2mU_1}}{\hbar} \geq \arctg \sqrt{\frac{m_1}{m_2} \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right)}.$$

Для меньших значений d , как было экспериментально подтверждено на примере одиночных квантовых ям GaAs/InGaAs/AlGaAs с асимметричными барьерами [2], связанного состояния не существует и соответствующий экситонный пик в спектрах фотолюминесценции исчезает.

В нашей предыдущей работе [3] исследовался закон дисперсии $E(k)$ для квантовых ям с асимметричными барьерами. Было показано, что локализованное состояние электрона существует в ограниченном диапазоне волновых векторов $(0, k_c)$ в направлении слоев структуры. При $k = k_c$ происходит 2D-3D трансформация состояний, причем электрическое поле позволяет управлять величиной k_c , то есть размерностью состояний. В настоящей работе методом фотолюминесценции предприняты детальные исследования этого эффекта в структурах одиночных квантовых ям GaAs/AlGaAs с асимметричными барьерами. Особенность измерений в электрическом поле состояла в том, что с ростом поля электрон имеет тенденцию к делокализации (исчезновению связанного состояния), в то время как для дырки, наоборот, квантовая яма становится глубже. Обнаружено, в частности, что, в отличие от [2],

¹⁾ e-mail: YURIALE@sci.lpi.ac.ru

связанные состояния экситона в структуре сохраняются в широком диапазоне электрических полей, когда локализованное состояние электрона в квантовой яме уже не существует.

Нелегированные квантовые ямы шириной $d = 10, 4$ и 3 нм, заключенные между верхним и нижним барьерными слоями $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ с составами $x = 0.4$ и $x = 0.06$ и толщинами 10 и 30 нм, соответственно, выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках полуизолирующего GaAs с буферным слоем GaAs толщиной 250 нм. Ширины квантовых ям были выбраны с таким расчетом, чтобы в структурах с $d = 10$ и 4 нм существовало связанное состояние электрона в яме без приложения внешнего электрического поля, а в структуре с $d = 3$ нм – отсутствовало. Возможность управления электрическим полем была предусмотрена за счет введения слоя $n^+\text{GaAs:Si}$ (10^{18} см^{-3}) толщиной 50 нм после буферного слоя в качестве нижнего электрода и легирования верхнего защитного слоя GaAs толщиной 10 нм примесью Si до уровня 10^{18} см^{-3} . Активные слои структуры были заключены между верхним и нижним спайсерами $n^+\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As:Si}$ с составами $x = 0.4$, $x = 0.06$ и толщинами $30, 25$ нм, соответственно. Уровни легирования спайсеров ($6.5 \cdot 10^{17}\text{ см}^{-3}$ для верхнего слоя и $(3 - 6) \cdot 10^{16}\text{ см}^{-3}$ для нижнего) были подобраны таким образом, чтобы обеспечить выполнение условия плоских зон в отсутствие внешнего воздействия. Спектры фотолюминесценции измерялись при температуре 80 К и возбуждении излучением Ar^+ -лазера с длиной волны 488 нм и плотностью мощности на образце не более 40 Вт/ см^2 . Спектры анализировались двойным монохроматором ДФС-24 и регистрировались ФЭУ в режиме счета фотонов.

На рис.1 представлены спектры структур с $d = 10, 4$ и 3 нм (спектры a, b и c , соответственно), а на вставке – коротковолновые участки соответствующих спектров. Общие для всех спектров пики B_1 и B_2 при 1.585 и в области 2.07 эВ обусловлены вкладами нижнего и верхнего барьерных слоев AlGaAs . Положение этих пиков с учетом энергий связи экситонов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ [4] подтверждает близость составов слоев к номинальным с $x = 0.06$ и 0.4 . В спектре a доминирует интенсивный пик экситона W , обусловленного первыми подуровнями размерного квантования электронов и тяжелых дырок ($C1 - H1$) в квантовой яме шириной 10 нм. При $d = 4$ нм пик квантовой ямы W приближается к пику низкого барьера B_1 , а также теряет интенсивность и уширяется, так как подуровень $C1$ оказывается вблизи потолка низкого барьера. В спектре структуры с $d = 3$ нм, где связанное состояние электрона в яме отсутствует, проявляется только пик люминесценции низкого барьера B_1 .

Для того чтобы проследить за эволюцией экситонного состояния квантовой ямы при плавном изменении высоты низкого барьера, на структуры с $d = 4$ и 3 нм был напылен верхний полупрозрачный электрод из Ni и приготовлены контакты к нему и к буферному n^+ -слою. По мере изменения приложенного к полупрозрачному электроду напряжения U от $+0.4$ до 1.4 В лик фотолюминесценции $C1 - H1$ для структуры с $d = 4$ нм теряет интенсивность, уширяется и медленно смещается к меньшим энергиям (кривая 1 на рис. 2), так как квадратичный эффект Штарка для прямых переходов незначителен, а эффект Франца – Келдыша оказывается меньше величины ошибки в наших измерениях. По тем же причинам положение экситонного пика низкого барьера B_1 остается практически неизменным (кривая 2), хотя он тоже ослабевает и уширяется с уменьшением U из-за ослабления кулоновского притяжения формирующих экситон электрона и дырки в электрическом поле. В

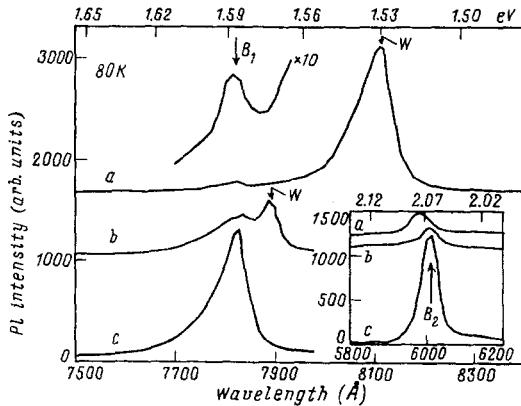


Рис.1. Спектры фотолюминесценции структур с $d = 10$ (a), 4 (b) и 3 (c) нм при температуре 80 К. На вставке – коротковолновые участки соответствующих спектров, измеренные при 10–20-кратном усилении

ослаблении пика $C1 - H1$ для структуры с $d = 4$ нм помимо этого фактора важную роль играет также увеличение асимметрии потенциального рельефа для электронов с уменьшением U .

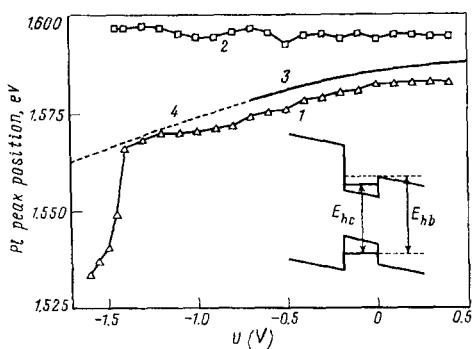


Рис.2. Зависимости от напряжения, приложенного к верхнему полупрозрачному электроду, для экситонных пиков $C1 - H1$ (кривая 1) и низкого барьера (кривая 2), а также для энергий E_{hc} и E_{hb} структуры с $d = 4$ нм (кривые 3, 4). На вставке схематически проиллюстрирован выбор параметров E_{hc} и E_{hb}

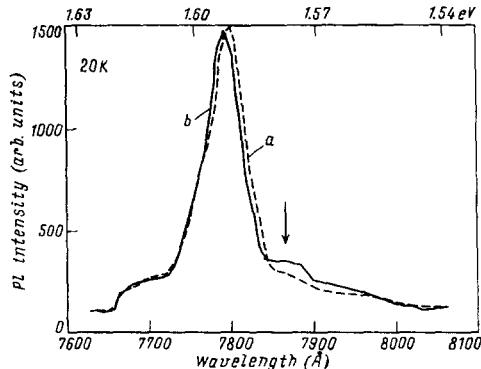


Рис.3. Спектры фотолюминесценции структуры с $d = 3$ нм, измеренные при температуре 20 К и напряжениях на верхнем электроде -1.0 В (a) и $+0.6$ В (b). Стрелкой отмечен вклад экситона квантовой ямы

Для интерпретации полученных результатов проводился расчет зависимости энергии локализованных состояний электронов и дырок от величины электрического поля E по методике, аналогичной [3]. Пересчет E в величину разности потенциалов U , приложенную к образцу, осуществлялся на основе решения уравнения Пуассона с учетом всех слоев, формирующих структуру. Линия 3 на рис.2 соответствует полученной таким образом энергией переходов $C1 - H1$ (переход E_{hc} на вставке к рис.2). Отметим, что в значительной области напряжений (от $+0.4$ до -0.6 В) экспериментальная и теоретическая кривые почти параллельны, так как уменьшение энергии связи экситона $C1 - H1$ с уменьшением U компенсируется все большим проникновением электронной волновой функции в низкий барьер, где за счет большей эффективной массы и меньшей диэлектрической проницаемости AlGaAs по сравне-

нию с GaAs энергия связи экситона выше. Согласно расчетам, в области $U_c = -0.6$ В электронный уровень выходит из ямы.

Несмотря на выход электронного уровня из ямы при $U_c = -0.6$ В, экситонный пик квантовой ямы W наблюдается и при $U < U_c$. Последнее обстоятельство можно объяснить, привлекая представления, аналогичные модели "кулоновской ямы". Эта модель успешно используется для объяснения значительных сил осцилляторов экситонных переходов в гетероструктурах (In,Ga)As/GaAs, CdTe/(Cd,Zn)Te и CdTe/(Cd,Mn)Te с близким к нулю скачком валентной зоны (см., например, [5]). В нашем случае удерживающий электрон потенциал создает тяжелую дырку, для которой низкий барьер повышается с ростом отрицательного напряжения на верхнем электроде. Поэтому переход $C1 - H1$ в структуре с $d = 4$ нм остается прямым в реальном пространстве и соответствующий экситонный пик наблюдается в спектрах и при напряжениях ниже $U_c = -0.6$ В. Дополнительный удерживающий электрон кулоновский потенциал увеличивает глубину ямы для электрона на величину δ , составляющую несколько мэВ. Это приводит к смещению U_c в сторону меньших U в меру отношения δ к исходной высоте низкого барьера, однако пик люминесценции наблюдается и при существенно меньших U . В области -1.4 В $< U < U_c$ люминесценция скорее всего обусловлена переходом между состоянием локализованной дырки $H1$ и электронными состояниями непрерывного спектра, энергия которых находится вблизи потолка низкого барьера (величина E_{hb} на вставке к рис.2). Пунктирная кривая 4 на рис.2 отражает зависимость E_{hb} от U . Максимум волновой функции для таких состояний уже находится в барьере. По своей природе это – квази-3D экситон. В области напряжений на структуре от -0.7 до -1.2 В экспериментальная кривая на рис. 2 сближается с кривой 4 за счет уменьшения энергии связи экситона с ростом поля.

Резкая зависимость положения пика люминесценции от напряжения в области $U < -1.4$ В свидетельствует о том, что в этой области экситон становится существенно непрямым. Существование такого экситона возможно только при наличии некоторой структуры в непрерывном спектре электронных состояний. По нашему мнению, эта структура может быть обусловлена резонансами в непрерывном спектре из-за отражений на скачке потенциала, сформированного на гетерогранице барьера Al_{0.06}Ga_{0.94}As и нижнего контактного слоя n^+ GaAs. В таком случае экситон формируется электроном в резонансном состоянии и локализованной в квантовой яме тяжелой дыркой, а необходимое для конечной силы осциллятора перекрытие соответствующих волновых функций обеспечивается за счет туннелирования электронов резонансного состояния в квантовую яму через треугольный барьер. При изменении напряжения на структуре от -1.4 до -1.6 В ширина треугольного барьера на уровне резонансного состояния меняется от 0 до 25 нм.

При напряжениях от -1.4 до -1.6 В нами отмечена сильная нелинейность зависимости интегральной интенсивности пика квантовой ямы W от мощности возбуждающего излучения, объясняемая экранированием внешнего электрического поля фотовоизбужденными носителями заряда. Экранирование приводит к тому, что с ростом мощности возбуждающего излучения действующее поле уменьшается и становится соответствующим пологому участку зависимости 1 на рис.2, где квази-3D экситон является прямым, и интенсивность пика W резко возрастает. Пик экситона квантовой ямы удается проследить в спектрах структуры с $d = 4$ нм до напряже-

ния -1.6 В. При более высоких напряжениях электрическое поле разрывает квази-3D надбарьерный экситон. Трехмерный экситон низкого барьера $\text{Al}_{0.05}\text{Ga}_{0.95}\text{As}$ разрывается более слабым полем, о чем свидетельствует исчезновение соответствующего пика B_1 уже при напряжении -1.45 В (кривая 2 на рис. 2).

Нами была также предпринята попытка сформировать связанное электронное состояние в электрическом поле. В структуре с $d = 3$ нм при температуре 80 К и $U = 0$ связанного состояния электрона в квантовой яме нет, поэтому в спектре люминесценции удается зарегистрировать только пик низкого барьера b_1 (спектр с на рис.1). Понижение температуры до 20 К сопровождается появлением в структурах долгоживущих состояний, которыми обусловлено сильное встроенное поле, противодействующее внешнему электрическому полю. Встроенное поле приводит к тому, что даже при напряжении -1.0 В на структуре с $d = 3$ нм в спектре заметно слабое плечо, вызванное вкладом экситона квантовой ямы (стрелка в спектре а на рис.3). Пики при 1.59 и 1.62 эВ обусловлены вкладами экситонов низкого барьера соответственно с тяжелой и легкой дырками. С ростом напряжения на структуре происходит уменьшение асимметрии потенциального рельефа для электронов, электронное состояние оказывается в яме, и интенсивность экситона квантовой ямы растет (пик против стрелки в спектре б на рис.3, измеренном при напряжении на структуре $+0.6$ В).

Авторы выражают признательность В.И.Цехошу за выращивание структур и С.С.Шмелеву за литографию и изготовление контактов. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Российской МНТП "Физика твердотельныхnanoструктур".

-
1. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, *Теоретическая физика, III*, М.: Наука, 1989.
 2. K.Pieger, J.Straka, A.Forchel et al., Proc. MRS Fall, Boston, 1993, p.255.
 3. В.В.Капаев, Ю.В.Копаев, Письма в ЖЭТФ **65**, 188 (1997).
 4. L.Pavesi and M.Guzzi, J. Appl. Phys. **75**, 4779 (1994).
 5. A.V.Kavokin, M.A.Kaliteevski, S.V.Goupalov et al., Phys. Rev. **B 54**, R11078 (1996).